การเตรียมฟิล์มบาง $\mathrm{Cu}(\mathrm{In}_{1-x}\mathrm{Ga}_x)\mathrm{Se}_2$ โดยวิธีการระเหยร่วม

และการศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์ม





วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2543

ISBN 974-346-143-4

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

I19498871

PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF Cu(In_{1-x}Ga_x)Se₂ THIN FILMS DEPOSITED BY A COEVAPORATION METHOD

Mr. Sakthavorn Phongwanitchaya

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Physics Department of Physics Faculty of Science Chulalongkorn University Acadamic Year 2000 ISBN 974-346-143-4

| หัวข้อวิทยานิพนธ์ | การเตรียมฟิล์มบาง Cu(In _{1-x} Ga _x)Se ₂ โดยวิธีการระเหยร่วมและ |
|----------------------|--|
| | การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์ม |
| โดย | นาย ศักดิ์ถาวร พงศ์วณิชยา |
| ภาควิชา | ฟิสิกส์ |
| อาจารย์ที่ปรึกษา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจรยศ อยู่ดี |
| อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ |
| | |

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

_____ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย โพธิ์พิจิตร)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

S-2 Z ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจรยศ อยู่ดี)

มีพางฟ ผิดมากรกรี อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงศ์ ฉัตราภรณ์)

Gullic กรรมการ

(อาจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน)

(ดร.ปียวุฒิ ศรีซัยกุล)

นายศักดิ์ถาวร พงศ์วณิชยา : การเตรียมฟิล์มบาง Cu(In_{1-x}Ga_x)Se₂ โดยวิธีการระเหยร่วมและการศึกษา ลักษณะเฉพาะของฟิล์ม. (PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF Cu(In_{1-x}Ga_x)Se₂ THIN FILMS DEPOSITED BY A COEVAPORATION METHOD) อ. ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ขจรยศ อยู่ดี, อ. ที่ ปรึกษาร่วม : ผศ.สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ , 149 หน้า. ISBN 974-346-143-4.

ฟิล์มบาง Cu(In_{1.x}Ga_x)Se₂ แบบผลึกพหุได้เตรียมลงบนแผ่นวัสดุรองรับที่ร้อนด้วยวิธีเคลือบไอแบบกายภาพจากระบบ แหล่งระเหยธาตุ 4 แหล่ง ภายใต้สุญญากาศในระดับ 10 ⁵ มิลลิบาร์ แผ่นวัสดุรองรับเป็นกระจกโซดาไลม์ที่ถูกเคลือบโมสิบดีนัม หนา 1 ไมครอน ด้วยวิธีดีซีสปัตเตอริง ฟิล์มบาง Cu(In, Ga)Se, ถูกเตรียมขึ้นด้วยกระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการ 2 ชั้น โดยชั้นแรกเป็นชั้นที่มี Cu มาก จะถุกเคลือบในอัตราส่วน Cu/(In+Ga) > 1 และจะเคลือบต่อเนื่องจนถึงชั้นที่สองที่มีเฉพาะ In Ga และ Se อุณหภูมิของแหล่งระเหย Cu In Ga และ Se คงที่ตลอดการเตรียมทั้งสองชั้น โดยในชั้นที่สองไม่มีการระเหย Cu ตลอด กระบวนการเตรียมใช้อัตราส่วน Se/(Cu+In+Ga) > 3 ขนาดเกรนและลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบางตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ้อิเล็กตรอนแบบสแกน โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางตรวจสอบด้วยวิธีเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ สัดส่วนอะตอมของฟิล์มบางตรวจสอบ พบว่าฟิล์มบาง Cu(In, Ga,)Se, มีความหนาประมาณ 2.5 ไมครอน ด้วยวิธี Energy-Dispersive X-ray Spectrometry ขนาดเกรนประมาณ 1 ไมครอน และสัดส่วนอะตอมอยู่ในช่วง 0.56 ≤ Cu/(In+Ga) ≤ 1.01 และ 0.18 ≤ Ga/(In+Ga) ≤ 0.55 มีโครงสร้างผลึกแบบชาลโคไพไรต์ ค่าคงตัวแลตติซ a=5.660-5.797 อังสตรอม และ c=11.329-11.615 อังสตรอม แสดงทิศทาง ของระนาบ (112) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง Cu(In, Ga,)Se, เตรียมขึ้นมาโดยเคลือบ CdS หนา 50 nm ด้วยวิธีเคลือบ แบบอาบสารเคมีเป็นชั้นกันชนบนฟิล์มบาง Cu(In_{1-x}Ga_x)Se₂ แล้วเคลือบตามด้วยฟิล์มบางโปร่งใสนำไฟฟ้า ZnO(AI) หนา 500 nm ด้วยวิธีอาร์เอฟสปัตเตอริง จากนั้นระเหย Al(Ni) ทำเป็นขั้วไฟฟ้าเพื่อวัดลักษณะเฉพาะของกระแสและความต่างศักย์ของ เซลล์แสงอาทิตย์ A!(Ni)/ZnO(Al)/ZnO/CdS/Cu(In,,Ga,)Se,/Mo/SLG โดยวัดที่การฉายแสงมาตรฐาน AM1.5 ความเข้ม เซลล์ที่ดีที่สุดมีพื้นที่รวม 0.49 cm² มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า 8.9 % 100 mW/cm^2 ความต่างศักย์วงจรเปิด 0.6 โวลต์ กระแสไฟฟ้าสัดวงจร 27.2 mA/cm² และฟิลแฟคเตอร์ 54.7 %

| ภาควิชา | .ฟิสิกส์ | | |
|------------|----------|------|--|
| สาขาวิชา | .ฟิสิกส์ | | |
| ปีการศึกษา | 2543 | | |

| ลายมือชื่อนิสิต | ศกิดลากร | พงศกณีชยา | |
|-----------------|------------------|-----------|------|
| ลายมือชื่ออาจา | รย์ที่ปรึกษา | NOCON of | 5 |
| ลายมือชื่ออาจา | รย์ที่ปรึกษาร่วม | NUMON DEN | MASS |

407 23936 23 : MAJOR PHYSICS KEY WORD: THIN FILMS / CIGS / SOLAR CELLS / SEM / COEVAPORATION

SAKTHAVORN PHONGWANITCHAYA : PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF Cu(In1-xGax)Se2 THIN FILMS DEPOSITED BY A COEVAPORATION METHOD. THESIS ADVISOR : ASSIST PROF. KAJORNYOD YOODEE,Ph.D., THESIS COADVISOR : ASSIST PROF.SOMPHONG CHATRAPORN, 149 pp. ISBN 974-346-143-4.

Polycrystalline Cu(In1-xGax)Se2 thin films were deposited on heated substrates by the physical vapor deposition technique from a four-source elemental evaporation system under a vacuum of 10⁻⁶ mbar. The substrates were soda-lime glass (SLG) coated by dc sputtering with a 1 µm thick Mo layer. The Cu(In1-xGax)Se2 film was deposited using the bi-layer process in which a Cu-rich layer with Cu/(In+Ga) > 1 was first deposited and followed continuously by a second layer containing only In, Ga and Se with Se/(Cu+In+Ga) > 3 throughout the process. In this process In, Ga and Se source temperatures were kept constant through both layers and the Cu source was simply turned off during the second layer deposition. The grain size and surface morphology of Cu(In_{1-x}Ga_x)Se₂ films were evaluated by a scanning electron microscope. X-ray diffraction and energy-dispersive X-ray spectrometry were used to analyse the crystal structure and composition of the films, respectively. It was found that these Cu(In_{1-x}Ga_x)Se₂ films obtained with ~ 2.5 μ m thickness have grain sizes of ~ 1 μ m and ratios of atomic compositions of $0.56 \le Cu/(In+Ga) \le 1.01$ and $0.18 \le Ga/(In+Ga) \le 0.55$. The crystal structure is chalcopyrite with lattice constants a=5.660-5.797 Å and c=11.329-11.615 Å dominated by a preferred (112) orientation. Cu(In1-xGax)Se2-based thin film solar cells were also fabricated a using a 50-nm-thick CdS buffer layer deposited by the chemical bath deposition technique. A 500 nm-thick transparent conducting ZnO(AI) film was then subsequently deposited by RF-sputtering. After evaporation of electrical grid Al(Ni), the current-voltage characteristics of these solar cells of AI(Ni)/ZnO(AI)/CdS/Cu(In1-xGax)Se2/Mo/SLG was measured under standard AM1.5 illumination with an intensity of 100 mW/cm². The best cell of total area 0.49 cm² had a conversion efficiency of 8.9 % with an open-circuit voltage of 0.6 V, a short-circuit current of 27.2 mA/cm² and a fill factor of 54.7 %.

DepartmentPhysicsField of studyPhysicsAcademic year2000

กิตติกรรมประกาศ



ฉ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ ผศ.ดร.ขจรยศ อยู่ดี

ผศ.สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ อ.ชาญวิทย์ จิตยุทธการ และ อ.พงษ์ ทรงพงษ์ ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำและข้อคิด เห็นต่างๆ ในการวิจัยมาด้วยดีตลอด

ขอขอบคุณ คุณ คมกฤษ ปนอุดม ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสปัตเตอร์ซิงค์ออกไซด์

ขอขอบคุณ คุณ บุญเหลือ เงาถาวรชัย เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ยี สำหรับการวิเคราะห์ฟิล์มบางด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบสแกน

ขอขอบคุณ คุณ จิระประภา เนียมปาน ภาควิชาธรณีวิทยา สำหรับการวิเคราะห์ฟิล์มบาง ด้วยเครื่อง Diffractometer

ขอขอบคุณ คุณ วรรลบ แดงงาม เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำ ที่ให้ความช่วยเหลืองานด้านต่างๆ ด้วยดีตลอดมา

ขอขอบคุณ คุณ ไปรมา ดิษฐูสมบูรณ์ ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเคลือบฟิล์มบางแคด-เมียมซัลไฟด์

ท้ายนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณ มารดา และพี่ทุกคน ที่ให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมาจน สำเร็จการศึกษา

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| บทคัดย่อภาษาไทย | 9 |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ | ବ |
| กิตติกรรมประกาศ | ପ୍ଟ |
| สารบัญ | ป |
| สารบัญตาราง | ป |
| สารบัญรูป | ୩ |
| บทที่ | |
| 1 บทน้ำ | 1 |
| 2 สารกึ่งตัวน้ำ | 4 |
| 2.1 ชนิดของสารกึ่งตัวน้ำ | 5 |
| 1. สารกึ่งตัวนำที่ประกอบด้วยธาตุเดี่ยว | 5 |
| 2. สารกึ่งตัวน้ำที่ประกอบด้วยธาตุเดี่ยวสองชนิด | 5 |
| 3. สารกึ่งตัวน้ำที่ประกอบด้วยธาตุเดี่ยวสามชนิด | 6 |
| 4. โลหะผสมกึ่งตัวนำ | 6 |
| 2.2 โครงสร้างผลึกของสารกึ่งตัวน้ำ | 7 |
| 1. โครงสร้างผลึกแบบเพชร | . 7 |
| 2. โครงสร้างผลึกแบบซิงค์เบลนด์ | . 7 |
| 3. โครงสร้างผลึกแบบซาลโคไพไรต์ | . 8 |
| 2.3 โครงสร้างแถบพลังงานของสารประกอบกึ่งตัวน้ำ I-III-VI ₂ | 10 |
| 3 ทฤษฎีการระเหย | 15 |
| 3.1 บทน้ำ | . 15 |

สารบัญ (ต่อ)

| | | หน้า |
|---|--|------|
| | 3.2 การกระจายตัวของไอ | 16 |
| | 3.3 ทฤษฎีการระเหยร่วม | 28 |
| | 3.3.1 กระบวนการเกิดฟิล์มบาง Cu(In _{1-x} Ga _x)Se ₂ | 29 |
| 4 | วิธีการวิเคราะห์สารกึ่งตัวนำ | 34 |
| | 4.1 การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ | 34 |
| | 4.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน | 39 |
| | 4.2.1 หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน | 39 |
| | 1. การชนแบบยืดหยุ่น | 39 |
| | 2. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น | 41 |
| | 4.2.2 Energy-Dispersive X-Ray Spectrometer (EDS) | 43 |
| | 4.3 การวัดด้วยวิธีขั้วความร้อน | 43 |
| | 4.4 การเตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง Cu(In _{1-x} Ga _x)Se ₂ | 44 |
| | 4.4.1 สปัตเตอริง (Sputtering) | 45 |
| | 4.4.2 การเคลือบแบบอาบสารเคมี (Chemical bath deposition) | 47 |
| | 4.4.3 การระเหย (Evaporation) | 48 |
| | 4.4.4 ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานเชิงอุดมคติ (Ideal conversion efficiency) | 49 |
| Ļ | 5 การทดลองและผลการทดลอง | 54 |
| | 5.1 การสร้างชุดแหล่งระเหยและฮีทเตอร์ | . 56 |
| | 5.1.1 การหาอุณหภูมิของฮีทเตอร์ที่ทำให้แผ่นวัสดุรองรับแอ่น | 58 |
| | 5.2 การปรับเทียบ (Calibrate) อุณหภูมิของแหล่งระเหย | . 61 |
| | 5.2.1 การคำนวณหาอุณหภูมิของแหล่งระเหยสำหรับเตรียมฟิล์มบาง CIGS | 68 |

สารบัญ (ต่อ)

| | ٩ | หน้า |
|-----|--|------|
| 5.3 | การเตรียมกระจกโซดาไลม์ | 73 |
| 5.4 | ผลการทดลองจากการวัดสมบัติต่างๆ ของฟิล์มบาง CIGS ที่เตรียมขึ้นมาด้วยอุณหภูมิ | |
| | ของแหล่งระเหยที่คำนวณจากความหนาที่วัดโดยใช้วิธีโทลันสกี | 73 |
| | 5.4.1 ลักษณะผิวหน้าและสัดส่วนอะตอมของฟิล์มบาง CIGS | 74 |
| | 5.4.2 โครงสร้างผลึกของฟิล์มบาง CIGS | 85 |
| | 5.4.3 ชนิดการนำไฟฟ้าของฟิล์มบาง CIGS | 87 |
| | 5.4.4 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS | 87 |
| 5.5 | ผลการทดลองจากการวัดสมบัติต่างๆ ของฟิล์มบาง CIGS ที่เตรียมขึ้นมาด้วยอุณหภูมิ | |
| | ของแหล่งระเหยที่คำนวณจากความหนาที่วัดโดยใช้วิธีโทลันสกีด้วยแหล่งระเหยที่ใช้ | |
| | ขดลวดแทนทาลัมขดใหม่ | 98 |
| | 5.5.1 ลักษณะผิวหน้าและสัดส่วนอะตอมของฟิล์มบาง CIGS | 98 |
| | 5.5.2 โครงสร้างผลึกของฟิล์มบาง CIGS | 106 |
| | 5.5.3 ชนิดการนำไฟฟ้าของฟิล์มบาง CIGS | 109 |
| | 5.5.4 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS | 110 |
| 5.6 | ผลการทด <mark>ลองจากการวัดสมบัติต่างๆ ของฟิล์มบาง C</mark> IGS ที่เตรียมขึ้นมาด้วยอุณหภูมิ | |
| | ของแหล่งร ะเหยที่คำนวณจากความหน าที่วัดโด ยใช้ผลึกวัดความหนาด้ วยแหล่งระเหย | |
| | ที่ใช้ขดลวดแทนทาลัมขดใหม่ | 117 |
| | 5.6.1 ลักษณะผิวหน้าและสัดส่วนอะตอมของฟิล์มบาง CIGS | 117 |
| | 5.6.2 โครงสร้างผลึกของฟิล์มบาง CIGS | 124 |
| | 5.6.3 ชนิดการนำไฟฟ้าของฟิล์มบาง CIGS | 127 |
| | 5.6.4 เขลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS | 128 |

สารบัญ (ต่อ)

| ۶V | |
|-----|--|
| หนา | |

| 6 สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง | 132 |
|------------------------------|-----|
| ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย | 137 |
| ข้อเสนอแนะ | 138 |
| รายการอ้างอิง | 139 |
| ภาคมนวก | 143 |
| ภาคมนวก ก | 143 |
| ภาคผนวก ข | 146 |
| ภาค มนวก ค | 147 |
| ประวัติผู้วิจัย | 149 |

....

สารบัญตาราง

| ตารางที่ | เน้า |
|--|------|
| 4.1 แสดงวิธีต่างๆ ในการเตรียมฟิล์มบางแต่ละชั้นของเซลล์แสงอาทิตย์ | 45 |
| 5.1 แสดงสมบัติของธาตุที่นำมาใช้ในระบบเตรียมฟิล์มบาง | 56 |
| 5.2 แสดงอัตราการเคลือบฟิล์มบาง Cu ที่อุณหภูมิของแหล่งระเหยต่างๆ | 66 |
| 5.3 แสดงข้อมูล In(R) และ 1/T สำหรับคำนวณหาค่า S และ b ของแหล่งระเหย Cu | 66 |
| 5.4 แสดงข้อมูลอัตราการเคลือบฟิล์มบางที่อุณหภูมิต่างๆ ของแหล่งระเหย In,Ga และ Se | 67 |
| 5.5 แสดง ค่า S และ b ของแหล่งระเหย Cu,In,Ga และ Se | 68 |
| 5.6 แสดงความหนาของฟิล์มบางที่ใช้คำนวณหาอุณหภูมิของแหล่งระเหย | 69 |
| 5.7 แสดงค่า R และ In(R) ของฟิล์มบาง Cu,In และ Ga | 70 |
| 5.8 แสดงอุณหภูมิของแหล่งระเหยที่ได้จากการคำนวณสำหรับเตรียมฟิล์มบาง CIGS | 70 |
| 5.9 แสดงพื้นที่ใต้กราฟรวมของยอด Cu,In,Ga และ Se จากการวัดโฟตอนรังสีเอกซ์ของ | |
| ผลึกมาตรฐาน CIGS จุดที่ 1,2 และ 3 | 78 |
| 5.10 แสดงพื้นที่ใต้กราฟรวมของยอด Cu,In,Ga และ Se จากการวัดโฟตอนรังสีเอกซ์บน | |
| ผิวหน้าฟิล์มบาง CIGS2 | . 79 |
| 5.11 แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu,in,Ga และ Se ที่ผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS2 | . 81 |
| 5.12 แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu,In,Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS2 | . 82 |
| 5.13 แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu,In,Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS3 | . 82 |
| 5.14 แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu,In,Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS4 | . 82 |
| 5.15 แสดงค่าคงตัวแลตติซ a และ c ของฟิล์มบาง CIGS2,CIGS3 และ CIGS4 | 85 |
| 5.16 ชนิดการนำไฟฟ้าของฟิล์มบาง CIGS2,CIGS3 และ CIGS4 | 87 |
| 5.17 แสดงข้อมูลจากการวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าแล ะความต่างศักย์ | |
| ของฟิล์มบาง CIGS2 และ CIGS3 | 94 |
| 5.18 แสดงค่า S และ b ใหม่ของแหล่งระเหย Cu,In และ Ga | 96 |

สารบัญตาราง (ต่อ)

| ตารางที่ | | หน้า |
|---------------|--|------|
| 5.19 | แสดงอุณหภูมิของแหล่งระเหยที่ใช้เตรียมฟิล์มบาง CIGS ของแหล่งระเหยใหม่ | 97 |
| 5.20 | แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS35 หนาประมาณ 1.70 ไมครอน | 99 |
| 5.21 | แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS36 หนาประมาณ 2.60 ไมครอน | 99 |
| 5.22 | แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS37 หนาประมาณ 2.20 ไมครอน | 99 |
| 5.23 | แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS38 หนาประมาณ 2.00 ไมครอน | 100 |
| 5.24 | แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS39 หนาประมาณ 2.00 ไมครอน | 100 |
| 5.25 | แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS42 หนาประมาณ 2.20 ไมครอน | 100 |
| 5.26 | แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS46 หนาประมาณ 2.00 ไมครอน | 101 |
| 5.27 | แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS48 หนาประมาณ 2.00 ไมครอน | 101 |
| 5.28 | แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS50 หนาประมาณ 1.60 ไมครอน | 101 |
| 5.29 | แสดงค่าคงตัวแลตติฃ a และ c ของฟิล์มบาง CIGS | 106 |
| 5.30 | แสดงขนิดการนำไฟฟ้าของฟิล์มบาง CIGS | 110 |
| 5.31 | แสดงข้อมูลที่ได้จากการวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ | 111 |
| 5.32 | แสดงอัตราการเคลือบฟิล์มบางที่อุณหภูมิของแหล่งระเหยต่างๆ ของ | |
| | แหล่งระเหย Cu,In และ Ga | 114 |
| 5. 3 3 | แสดงค่า S และ b ของแหล่งระเหย Cu,In และ Ga ชุดใหม่ซึ่งวัดความหนาด้วย | |
| | ผลึกวัดความหนา | 115 |
| 5.34 | แสดงอุณหภูมิของแหล่งระเหย Cu,In และ Ga ชุดใหม่ | |
| | สำหรับเตรียมฟิล์มบาง CIGS | 116 |
| 5.35 | แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS25 หนาประมาณ 1.70 ไมครอน | 118 |
| 5.36 | แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS26 หนาประมาณ 1.65 ไมครอน | 118 |
| 5.37 | แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS29 หนาประมาณ 3.30 ไมครอน | 118 |

สารบัญตาราง (ต่อ)

| ตารางที่ หน้า |
|--|
| 5.38 แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS30 หนาประมาณ 2.60 ไมครอน |
| 5.39 แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS31 หนาประมาณ 3.30 ไมครอน |
| 5.40 แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS32 หนาประมาณ 3.05 ไมครอน |
| 5.41 แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS33 หนาประมาณ 5.65 ไมครอน |
| 5.42 แสดงค่าคงตัวแลตติซ a และ c ของฟิล์มบาง CIGS 124 |
| 5.43 แสดงชนิดการนำไฟฟ้าของฟิล์มบาง CIGS 127 |
| 5.44 แสดงข้อมูลที่ได้จากการวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของ |
| เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS 128 |
| 6.1 แสดงอัตราส่วน Cu/(In+Ga) และ Ga/(In+Ga) ของฟิล์มบาง CIGS2,CIGS3 และ CIGS4 132 |
| 6.2 แสดงข้อมูลจากการวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของ |
| ฟิล์มบาง CIGS |
| 6.3 แสดงอัตราส่วน Cu/(In+Ga) และ Ga/(In+Ga) ของฟิล์มบาง CIGS ที่วัดโฟตอนรังสีเอกซ์ |
| คนละตำแหน่งบนแผ่นวัสดุรองรับเดียวกัน |
| 6.4 แสดงข้อมูลจากการวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของ |
| ฟิล์มบาง CIGS |
| 6.5 แสดงอัตราส่วน Cu/(In+Ga) และ Ga/(In+Ga) ของฟิล์มบาง |
| 6.6 แสดงข้อมูลจากการวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของ |
| ฟิล์มบาง CIGS |
| ก.1 แสดงข้อมูลของแต่ละแหล่งระเหยซึ่งใช้คำนวณในสมการ ก.3 |
| ค.1 แสดงข้อมูลที่ได้จากการวัดโฟตอนรังสีเอกซ์ของผลึกมาตรฐาน CIGS จุดที่ 1 |
| มีความคลาดเคลื่อน 3.81 % 14 |

สารบัญตาราง (ต่อ)

| ตาราง | ที่ | หน้า |
|-------|--|------|
| ค.2 | แสดงข้อมูลที่ได้จากการวัดโฟตอนรังสีเอกซ์ของผลึกมาตรฐาน CIGS จุดที่ 2 | |
| | มีความคลาดเคลื่อน 3.96 % | 147 |
| ค.3 | แสดงข้อมูลที่ได้จากการวัดโฟตอนรังสีเอกซ์ของผลึกมาตรฐาน CIGS จุดที่ 3 | |
| | มีความคลาดเคลื่อน 3.91 % | 148 |
| ค.4 | แสดงข้อมูลที่ได้จากการวัดโฟตอนรังสีเอกซ์บนผิวหน้าฟิล์มบาง CIGS2 | |
| | มีความคลาดเคลื่อน 3.15 % | 148 |

.

สารบัญรูป

| รูปที่ | เ ใ | , ำ |
|--------|--|--------|
| 1.1 | โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS | |
| 2.1 | แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสารประกอบกึ่งตัวน้ำที่ได้จากการแทนที่อะตอมลงใน | |
| | สารกึ่งตัวนำในหมู่ IV | 7 |
| 2.2 | แสดงโครงสร้างผลึกแบบเพชร (Diamond structure) | |
| 2.3 | แสดงโครงสร้างผลึกแบบซิงค์เบลนด์ (Zincblende structure) | |
| 2.4 | แสดงโครงสร้างผลึกแบบชาลโคไพไรต์ (Chalcopyrite structure) |) |
| 2.5 | แสดงบริลลันโซนแรก (First Brillouin zone) ของโครงสร้างผลึกแบบ | |
| | Face Center Cubic (FCC) 1 | ļ |
| 2.6 | แสดงบริลลันโซนของโครงสร้างผลึกแบบชาลโคไพไรต์ (เส้นทึบ) เทียบกับบริลลันโซน | |
| | ของโครงสร้างผลึกแบบซิงค์เบลนด์ (เส้นประ) เมื่อกำหนดค่า c/a = 2 |) |
| 2.7 | แสดงการแยกของแถบเวเลนซ์ในผลึกแบบชาลโคไพไรต์ | 3 |
| 2.8 | แสดงโครงสร้างแถบพลังงานของ CuInSe ₂ และ CuGaSe ₂ ที่มีโครงสร้างผลึก | |
| | แบบซาลโคไพไรต์1 | 1 |
| 3.1 | แสดงการกระจายตัวของฟลักซ์ไอที่มี ทิ ศทางของแหล่งกำเนิดตั้งฉากกับผิวของแผ่นวัสดุรองรับ | |
| | (a) แบบโคไซล์เดี่ยว (Single Cosine) จากแหล่งกำเนิดที่เป็นแบบจุด (Point source) | |
| | (b) ผลรวมของทุกๆ Cosine ที่อยู่เหนือแหล่งกำเนิด1 | 7 |
| 3.2 | ความสัมพันธ์เชิงเรขาคณิตของ | |
| | (a) แหล่งกำเนิดที่แผ่ฟลักซ์ไอ | |
| | (b) แหล่งกำเนิดที่แผ่ฟลักซ์ไอจากแหล่งกำเนิดถึงแผ่นวัสดุรองรับที่เรียบ | |
| | (c) ฟลักซ์ไอที่ตกลงบนแผ่นวัสดุรองรับที่เรียบ ซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมที่จุด A | |
| | และมีลักษณะเป็นวงรีที่จุด B 1 | 8 |

| รูปที่ | | หน้า |
|--------|--|------|
| 3.3 | การกระจายตัวของไอจากแหล่งกำเนิดที่มีลักษณะแตกต่างกัน | |
| | (a) dimple boat ขนาด 40x10 มม ² | |
| | (b) dimple boat ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 10 มม. และลึก 3 มม. | |
| | (c) ลวดยาว 40 มม. พันเป็นขดยาว 6,10 มม. | |
| | (d) ครูซิเบิลมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขนาด 10 มม. และสูง 12 มม | . 22 |
| 3.4 | สัมประสิทธิ์การกระจาย (Distribution coefficients) ใช้วัดหาค่าฟลักซ์ไอ | |
| | สำหรับอะลูมินัมที่ได้รับความร้อนจาก Electron bem heated source | 23 |
| 3.5 | การกระจายตัวที่ไม่เสถียร ให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดความหนาสำหรับไออะลูมินัม | |
| | ที่ได้รับความรัอนจาก Electron beam heated source | 24 |
| 3.6 | แสดงการกระจายตัวของฟลักซ์ไอที่ออกมาจากแหล่งระเหย | 25 |
| 3.7 | แสดงระบบเตรียมฟิล์มบาง CIGS ด้วยวิธีระเหยร่วม | 29 |
| 3.8 | แสดงโครงสร้างภายในของแหล่งระเหย | 30 |
| 3.9 | แสดงแผนผังการควบคุมอุณหภูมิของแหล่งระเหยและฮีทเตอร์ | 30 |
| 3.1 | 0 กระบวนการเกิดของฟิล์มบาง Cu(In _{1-x} Ga _x)Se ₂ | |
| | (a) การเกิดปฏิกิริยาขั้นเริ่มต้น | |
| | (b) เกิด Cu(In _{1-x} Ga _x)Se ₂ และ Cu _z Se | |
| | (c) เกิดขั้นของ Cu(In _{1-x} Ga _x)Se ₂ ในทิศตั้งฉากกับระนาบของแผ่นวัสดุรองรับ | |
| | (d) การเปลี่ยนรูปของ Cu _z Se และเกิดเป็นฟิล์มบาง Cu(In _{1-x} Ga _x)Se ₂ ในแนวระนาบ | 32 |
| 4.1 | แสดงการเลี้ยวเบนและทางเดินของรังสีเอกซ์ตามเงื่อนไขของแบรกก์ | 35 |
| 4.2 | แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนของฟิล์มบาง Cu(In _{1-x} Ga _x)Se ₂ | 38 |
| 4.3 | แสดงเครื่อง Diffractometer ที่ใช้ในการวัดรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS | |
| | (จากภาควิชา ธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | 38 |

| รูปา | ai A | หน้า |
|------|---|------|
| 4.4 | แสดงโครงสร้างของกล้อง SEM (Scanning Electron Microscopy) | . 40 |
| 4.5 | แสดงผลที่เกิดจากอันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนปฐมภูมิกับอะตอมของตัวอย่าง | . 40 |
| 4.6 | ร แสดงปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากอันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนปฐมภูมิกับ | |
| | อะตอมของตัวอย่าง | 41 |
| 4.7 | ้ แสดงการเกิดรังสีเอกซ์ | 42 |
| 4.8 | 3 แสดงการตรวจสอบชนิดการนำไฟฟ้าของฟิล์มบาง CIGS ด้วยวิธีขั้วความร้อน | 44 |
| 4.9 |) แสดงโครงสร้างเซลลแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS ที่เตรียมขึ้นเอง | . 45 |
| 4.1 | 10 แสดงระบบและกระบวนการสปัตเตอริงอย่างง่าย | 46 |
| 4.1 | 1 แสดงวิธีการเตรียมฟิล์มบางแบบวิธีการระเหย | . 48 |
| 4.1 | 12 (a) ไดอะแกรมแถบพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์แบบรอยต่อพีเอ็นภายใต้การแผ่รังสี | |
| | จากดวงอาทิตย์ | |
| | (b) วงจรสมมูลย์ของเซลล์แสงอาทิตย์แบบอุดมคติ | . 49 |
| 4.1 | 13 (a) ความสัมพันธ์ของกระแสและความต่างศักย์ของเซลล์แสงอาทิตย์ ภายใต้ | |
| | สภาพการฉายแสง | |
| | (b) ส่วนกลับ (Inverse) ของกราฟ (a) | 51 |
| 4.1 | 14 แสดงความสัมพันธ์ของกระแสและความต่างศักย์ของเซลล์แสงอาทิตย์ | |
| | รวมทั้งความต้านทานอนุกรมและความต้านทานชันต์ | . 52 |
| 5.1 | 1 ใดอะแกรมแสดงขั้นตอนการทำงาน | 55 |
| 5.2 | 2 แสดงแหล่งระเหยที่สร้างขึ้นมา | 57 |
| 5.3 | 3 แสดงชุดระบบเตรียมฟิล์มบาง CIGS | 57 |
| 5.4 | 4 แสดงโครงสร้างของฮีทเตอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ความร้อนแก่แผ่นวัสดุรองรับ | |
| | และแผนภาพการควบคุมอุณหภูมิของฮีทเตอร์ | 59 |

| รูปที่ | หน้า |
|---------|--|
| 5.5 กรา | าฟแสดงอุณหภูมิ TC1,TC2 และ TC3 |
| 5.6 แส | ดงวิธีการหาอุณหภูมิของฮีทเตอร์ที่ทำให้แผ่นวัสดุรองรับแอ่น |
| 5.7 กร | าฟแสดงอุณหภูมิของฮีทเตอร์ที่ทำให้แผ่นวัสดุรองรับแอ่น |
| 5.8 แส | ดงฟิล์มบาง Cu ทั้งหมด 14 แถบ ที่เคลือบบนแผ่นวัสดุรองรับ |
| 5.9 กร | าฟโปรไฟล์อุณหภูมิ (Temperature profile) ของฟิล์มบาง Cu |
| 5.10 n | ราฟแสดงความหนาของฟิล์มบาง Cu ที่อุณหภูมิ 1,001 C63 |
| 5.11 ก | ราฟแสดงความหนาของฟิล์มบาง Cu ที่อุณหภูมิต่างๆ ซึ่งยังไม่ได้ปรับตำแหน่ง |
| 6 | ข้าสู่ศูนย์กลางของการระเหย |
| 5.12 ก | ราฟแสดงความหนาของฟิล์มบาง Cu ที่อุณหภูมิต่างๆ ซึ่งปรับตำแหน่งเข้าสู่ |
| คู | ุ่นย์กลางของการระเหยแล้ว |
| 5.13 ก | ราฟแสดงอัตราการเคลือบฟิล์มบางของฟิล์มบาง Cu ที่อุณหภูมิต่างๆ |
| ្នំ | งปรับตำแหน่งเข้าสู่ศูนย์กลางของการระเหยแล้ว |
| 5.14 ก | เราฟแสดงความสมพันธ์ของสมการ ln(R) = <u>S</u> + b ของแหล่งระเหย Cu |
| 5.15 n | าราฟโปรไฟล์อุณหภูมิของการเตรียมฟิล์มบาง CIGS |
| 5.16 n | เราฟโฟตอนรังสีเอกซ์ของผลึกมาตรฐาน CIGS ที่วัดได้ |
| (1 | า) จุดที่ 1 ของผลึกมาตรฐาน CIGS |
| (1 | ป) จุดที่ 2 ของผลึกมาตรฐาน CIGS |
| (P | า) จุดที่ 3 ของผลึกมาตรฐาน CIGS75 |
| 5.17 r | าราฟโฟตอนรังสีเอกซ์ของผลึกมาตรฐาน CIGS ที่ตัดพื้นที่ของพื้นหลังออกไปแล้ว |
| 5.18 r | าราฟโฟตอนรังสีเอกซ์วัดที่ผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS2 |

| รูปที่ | หน้า |
|--------|--|
| 5.19 | แสดงตำแหน่งที่วัดสโฟตอนรังสีเอกซ์ตามแนวภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS |
| 5.20 | แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS2 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM |
| 5.21 | แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS3 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM |
| 5.22 | แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS4 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM |
| 5.23 | แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ CIGS2 |
| | $\frac{Cu}{In+Ga} = 0.56$ use $\frac{Ga}{In+Ga} = 0.27$ |
| 5.24 | แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ CIGS3 |
| | $\frac{Cu}{In+Ga} = 0.56$ was $\frac{Ga}{In+Ga} = 0.18$ |
| 5.25 | แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ CIGS4 |
| | $\frac{Cu}{\ln+Ga} = 0.56$ was $\frac{Ga}{\ln+Ga} = 0.25$ |
| 5.26 | แสดงวิธีการตรวจสอบหาด้านที่ไม่มีดีบุกเคลือบของกระจกโซดาไลม์ |
| 5.27 | ลักษณะการวางแผ่นวัสดุรองรับแบบวิธีดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง (BALZER BAE 250) |
| 5.28 | แสดงวิธีการเตรียมฟิล์มบาง CdS ด้วยกระบวนการเคลือบแบบอาบสารเคมี |
| 5.29 | แสดงการส่งผ่านแสง (Transmission,%) ของฟิล์มบาง ZnO/ZnO(Al) ที่เคลือบบนกระจก 91 |
| 5.30 | ลักษณะการวางแผ่นวัสดุรองรับแบบวิธีอาร์เอฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง (BALZER BAE 250) 92 |
| 5.31 | กราฟแสดงลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของเซลล์แสงอาทิตย์ |
| | ชนิดฟิล์มบาง CIGS2 |
| 5.32 | กราฟแสดงลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของเซลล์แสงอาทิตย์ |
| | ชนิดฟิล์มบาง CIGS4 |
| 5.33 | 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของสมการ ln(R) = <u>S</u> + b เพื ่อหาค่า b ใหม่ของแหล่งระเหย Cu 96 |
| 5.34 | ี แสดงโปรไฟล์อุณหภูมิการเตรียมฟิล์มบาง CIGS35,CIGS42,CIGS46 และ CIGS50 |

| รูปที่ | | หน้า |
|--------|--|-------|
| 5.35 | กราฟแสดงอัตราส่วน <u>Cu</u> _{In+Ga} และ <u>Ga</u> ที่ผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS | 102 |
| 5.36 | แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS35 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM | 102 |
| 5.37 | แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS36 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM | 103 |
| 5.38 | แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS37 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM | 103 |
| 5.39 | แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS38 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM | 103 |
| 5.40 | แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS39 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM | 104 |
| 5.41 | แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS42 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM | 104 |
| 5.42 | แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS46 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM | 104 |
| 5.43 | แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS48 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM | 105 |
| 5.44 | แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS50 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM | 105 |
| - 5.45 | แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS35 | 106 |
| 5.46 | แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS36 | 107 |
| 5.47 | แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS37 | 107 |
| 5.48 | แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS38 | 107 |
| 5.49 | แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS39 . | 108 |
| 5.50 | แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS42 . | 108 |
| 5.51 | แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS46 . | . 108 |
| 5.52 | แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS48 . | . 109 |
| 5.53 | แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS50 . | . 109 |
| 5.54 | กราฟแสดงลักษณะเฉพาะของกระแลไฟฟ้าและความต่างศักย์ของเซลล์แสงอาทิตย์ | |
| | ชนิดฟิล์มบาง CIGS35,36,37,38,39,42,46,48 และ 50 | 112 |

| รูปที่ | หน้า |
|--------|---|
| 5.55 | กราฟแสดงความสัมพันธ์ของสมการ ln(R) = ^ร _T + b 115 |
| 5.56 | แสดงโปรไฟล์อุณหภูมิการเตรียมฟิล์มบาง CIGS25,26,29,30,31,32 และ 33 117 |
| 5.57 | กราฟแสดงอัตราส่วน <u>Cu</u> _{In+Ga} และ <u>Ga</u> ที่ผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS |
| 5.58 | แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS25 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM 121 |
| 5.59 | แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS26 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM 121 |
| 5.60 | แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS29 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM 121 |
| 5.61 | แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตั ด ขวางของฟิล์มบาง CIGS30 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM 122 |
| 5.62 | แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS31 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM 122 |
| 5.63 | แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS32 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM 123 |
| 5.64 | แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS33 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM 123 |
| 5.65 | แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS25124 |
| 5.66 | แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS26125 |
| 5.67 | แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS29125 |
| 5.68 | แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS30126 |
| 5.69 | แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีเลี้ยวเบนของ รังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS31126 |
| 5.70 | แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีเลี้ยวเบนของ รังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS 32126 |
| 5.71 | แสดงลวดลายการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS33127 |
| 5.72 | กราฟแสดงลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของเซล <mark>ล์แสงอาทิตย์</mark> |
| | ชนิดฟิล์มบาง CIGS25,26,29,30,31,32 และ 33 129 |
| 5.73 | กราฟเปรียบเทียบระหว่างอัตราส่วน ^{Cu} In+Ga กับ η และ Ga กับ η ของฟิล์มบาง CIGS |
| | ที่นำมาเตรียมเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ |

| รูปที่ | | หน้า |
|--------|---|-------|
| ก.1 | กราฟแสดงข้อมูลดิบของอัตราการเคลือบฟิล์มบางกับข้อมูลที่คำนวณจากสมการ (ก.3) | |
| | ได้ n=1 ของแหล่งระเหย Cu | 144 |
| ก.2 | กราฟแสดงข้อมูลดิบของอัตราการเคลือบฟิล์มบางกับข้อมูลที่คำนวณจากสมการ (ก.3) | |
| | ได้ n=2 ของแหล่งระเหย In | 144 |
| ก.3 | กราฟแสดงข้อมูลดิบของอัตราการเคลือบฟิล์มบางกับข้อมูลที่คำนวณจากสมการ (ก.3) | |
| | ได้ n=1 ของแหล่งระเหย Ga | 145 |
| ก.4 | กราฟแสดงข้อมูลดิบของอัตราการเคลือบฟิล์มบางกับข้อมูลที่คำนวณจากสมการ (ก.3) | |
| | ได้ n=1 ของแหล่งระเหย Se | . 145 |
| ข.1 | แสดงการเกิดการแทรกสอดบนฟิล์มบางจากแลงโซเดียมด้วยวิธีโทลันสกี | . 146 |

.